

Sistema de Película Delgada TFS 200 para Investigación

LA estructura mecánica del TFS 200 consta de una pared caliente, una cámara de reacción con flujo continuo, integrado en la pared fría enfriada por agua en la cámara externa de vacío. Este diseño evita la condensación de los precursores y elimina disposición prejudicial en la pared de la cámara. Obleas de silicón, otros sustratos planares, objetos sólidos/porosos tridimensionales, y estructuras de fibra y polvo son todos posibles sustratos.

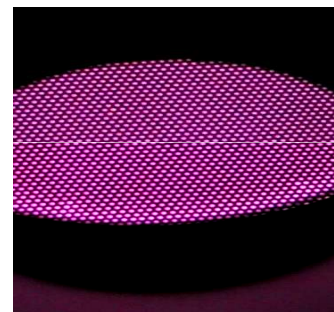
- Rendimiento: tiempo del ciclo < 2 s , variación de grosor menos de $\pm 1\%$ (Al_2O_3 / oblea de 200mm)
- Flexibilidad del sistema de fuentes:
 - Hasta 15 fuentes
 - Temperatura de la fuente de calor hasta 500° C
 - Fuente de plasma con funciones tanto remotas como directas y con varias opciones para el flujo de gas



Fuente de calor HS 200



Bloque de carga manual



Plasma en acción

TFS 200

Rango de temperatura de proceso	25 - 500° C
Tamaños de la cámara de reacción (Diámetro, Altura)	200mm, 5mm 200mm, 100mm 200mm, 30mm (cámara de plasma)
Gas lines	Hasta 8
Fuentes líquidas (+5° C - temperatura ambiental)	Hasta 3
Fuentes de calor HS 200 / HS 300 (temperatura ambiental - +200/300° C)	Hasta 4
Fuente de calor HS 500 (temperatura ambiental - +500° C)	Hasta 2
Opcional	Fuente de plasma, bloque de carga, sala de ventilación, caja de guantes integrada
Medidas principales, sistema de ALD (L x A x A)	1200 x 600 x 1300 mm
Medidas principales, Electric cabinet (L x A x A)	1000 x 300 x 1200 mm